研究報告 Ti:LiNbO₃光集積回路を用いた電界強度測定器の開発 伊藤博,市川正 Development of the Electric Field Meter Using Ti:LiNbO₃ Integrated Optics

Hiroshi Ito, Tadashi Ichikawa

要 旨

電磁妨害評価のための電界測定に,Ti:LiNbO₃光集積回路を用いた手法の適用を検討し,その有用性 を理論的に明らかにした。新たに考案した反射型 Mach-Zehnder 光変調器の光集積回路素子を用いて2種 類(低周波用,高周波用)の電界センサを試作し,小型(43×16×10mm,43×45×10mm)で広帯域 (30Hz - 100kHz, 30MHz - 1GHz),広測定範囲(0.01 - 1000V/m,0.6-300V/m)の特性を確認した。

Abstract

For measuring electromagnetic field, a sensor using a Ti:LiNbO₃ integrated optics has several advantages of small size, fast frequency response and minimum perturbation for the field to be measured. Using a novel retroreflective type of Mach-Zehnder waveguide modulator, two small-sized ($43 \times 16 \times 10$ mm, $43 \times 45 \times 10$ mm) electric field sensors have been developed. These sensors were found to have wide dynamic ranges (0.01-1000 V/m, 0.6-300 V/m) and wide frequency band widths (30 Hz - 100 kHz, 30 MHz - 1 GHz).

キーワード 米集積回路,光応用計測,電界計測,電磁妨害,EMI,導波型光変調器,LiNbO₃

1.はじめに

近年,自動車の車載電子機器は増加の一途をたどっ ており,エンジン,サスペンション,ブレーキなどの 基本的な機能・性能のエレクトロニクスへの依存度が 年々高まっている。これにともない,それらの信頼性 は,非常に高いものが要求されるようになってきてい る。そのような背景にもとづき,電磁妨害(EMI; Electro Magnetic Interference)への耐性も重要な評価項 目にあげられており,車をとりまく電磁界環境の把握 等も各方面で精力的に行われている。しかし,この調 査においては車室内外の電界分布計測が,特に車載電 子機器のECU(Electronic Control Unit)周辺の詳細な 計測が行われる。これに対してループアンテナ等を用 いる現状の測定器は大型で,このような狭い場所で使 用することが困難であった。また,金属の信号ケーブ ルはセンサの自由な据え付けを妨げるだけではなく、 被測定電界まで乱してしまうなどの問題があった。ま た, EMIを生起しうる電界を発生する源も種々のもの があり,電界強度測定範囲は最大で1000V/m,周波数 帯域も自動車電話や業務無線の1GHz付近から超高圧 送電線の下などのELF電界 (f < 3kHz) までもがその評 価項目に加えられている。このような事情から、上述 の広い測定範囲をカバーし,かつ車室内のような狭い 場所で使用できる小型で有効な測定器が強く望まれて いた。今回,我々は電界計測のセンサ部にTi:LiNbO3 光集積回路の導波型光変調器を用いる手法1~3)に着目 して, EMI評価用電界計測への適用の可能性を検討し た。その結果, 商用電源周波数(50,60Hz)から1GHz 以上の周波数の電界まで計測できる見通しが得られ, 実際に高圧送電線下の車室内電界測定までもが可能な 電界センサを開発したので報告する。

2.理論検討

2.1 測定原理

Ti:Li Nb O₃ (以下LNと記す) 導波型光変調器をセンサ部に用いた電界強度測定器のプロック図をFig. 1 に示す^{4,5)}。被測定電界中には,LN導波型光変調器 と電界検出のアンテナよりなるセンサ部だけが置か れ,光源,光検出器,信号処理の電子回路などは遠く 離れて設置され,その間は光ファイバで結ばれる構成 になっている。動作は次のようになる。

光源からの連続光は,光ファイバによりセンサ部の LN導波型変調器に伝送される。変調器には電界検出 アンテナがつながっており,電界強度に応じて変調器 への印加電圧が変化し,結果として電界強度に応じて, 変調器の出射光強度が変化する。この出射光を再び光 ファイバで光検出器・信号処理回路まで伝送し,そこ で到達した光強度を測定することにより,センサ部に 加わった電界強度が測定される。

この方式には,センサ部はアンテナを除いて全て誘 電体で構成されており,信号伝送路も光ファイバであ ることから,測定しようとする電界をほとんど乱さな い特長がある。

Fig. 1の構成のシステムの特性式を考える。入力は 被測定電界強度*E*,,出力としては光検出器の出力電流 *i*,を考える。この場合のシステム出力の特性は式(1)で 表される。

$$\mathbf{i}_{s} = \mathbf{G}_{a}\mathbf{G}_{d}\mathbf{G}_{m}\mathbf{G}_{fu}\mathbf{G}_{fd}\mathbf{P}_{a}\mathbf{E}_{s} \tag{1}$$

ここで G_a , G_d , G_m , G_{fa} , G_{fd} は各々アンテナ, 光検 出器, LN導波型光変調器, 光ファイバの伝達関数, *P*。は光源の出力強度である。次に各々の伝達関数について検討する。

2.2 導波型光変調器

これまでに提案されているLN導波型光変調器には Mach-Zehnder干渉計型(以下MZ型),方向性結合器型, 交差型,バランスドブリッジ型などの多くの形式があ る⁶)。これらの形式の中ではMZ型が現状では最も広 帯域で,かつ低電圧動作が可能である。このことはセ ンサに用いる場合,最も高感度が得られるということ になる。やや挿入損失が大きいという点は,光交換機 など多段接続で用いられる場合には問題だが,本検討 のように単独使用で光源出力も充分なときには問題は 少なく,高感度,広帯域,構成が簡単等の特長の方が 有用である。Fig.2に通常の光通信用MZ型光変調器 の形状と特性を示す。MZ型光変調器の伝達関数G_mは 次のようになる。

$$\boldsymbol{g}_{m}(\boldsymbol{V}_{s}) = (1 - \alpha_{m}) \cdot \mathbf{c} \, \mathbf{o} \, \mathbf{s}^{2} \, \left(\frac{\pi \boldsymbol{V}_{s}}{2 \boldsymbol{V}_{\pi}} + \frac{\phi_{o}}{2}\right) \tag{2}$$

ここで V_s は変調器入力電圧, α_m は変調器の挿入損失, V_π は半波長電圧, ϕ_o は固定位相バイアスで,分岐した二 つの導波路の長さの差で設定する。半波長電圧よりも充 分小の小信号入力動作を考え,式(2)を微分して,

$$\boldsymbol{G}_m = \frac{\boldsymbol{\pi}(1 - \boldsymbol{a}_m)}{2\boldsymbol{V}_{\boldsymbol{\pi}}} \tag{3}$$

ただし, φ_aは最良の直線性を得るためπ/2に設定し てあるものとする。また変調器動作の基本となってい るLNのポッケルス効果は100GHz以上の応答が可能⁷⁾ であるが,実際には変調器電極への給電方法により制 限される。一般的な中央給電を考えた場合,光波が電



Fig. 1 Block diagram of electric field sensor using waveguide modulator.

極部分を通過する時間内に変調電圧が変化しないとい う条件が応答周波数の上限を決める。これを考慮して 光変調器伝達関数は次式となる。

$$G_{m} = \frac{\pi (1 - a_{m})}{2V_{\pi}} \cdot \frac{1}{1 + jw\tau}$$

$$t = \frac{n_{o} L_{m}}{c}$$

$$(4)$$

ここでn。は光導波路屈折率, L_mは変調器の電極長, c は光速である。Fig. 2に示したものは通常の光変調器で あるが,電界計測のセンサとしてはFig. 3に形状を示す 反射型MZ光変調器^{®)}がより適しており,本検討ではこ の形式を用いる。反射型MZ光変調器は通常の変調器の 中央を切断して切断端面に金属反射膜を蒸着した構造に なっている。これにより次のような特長を実現した。

光波は位相変調部を2回通過することになり,ほぼ2 倍の強度変調を受ける。すなわち,通常の素子と同 一素子寸法なら2倍の感度が得られ,同一電圧感度 ならほぼ半分の素子寸法でよく,小型化が達成できる。さらに素子寸法の半減は,電極間容量半減につながり高周波特性が改善できる。

光ファイバを1本しか必要とせず,片持ち式が容易 に構成でき,光ファイバの最小曲げ半径の制約を受 けず小型化,使い勝手向上が達成できる。

構成が単純で安定性が向上する。すなわち,光ファ イバと導波路の接続のような最も精密な調整を必要 とし,機械的ずれのため特性の変化を起こしやすい 部位が1箇所になる。

2.3 電界検出アンテナ

電界を検出するアンテナは,システムの性格を決定 する重要な素子である。遠方界における放射電界の強 度の測定には一般的にはダイポールアンテナが用いら れる。しかし,本検討における電界強度測定器の狙い の一つはELF電界の測定,特に商用電源周波数の電界 強度測定である。そのために極めて低い周波数の電界



Fig. 2 Conventional Mach-Zehnder interferometric waveguide modulator.



Fig. 3 Retroreflective Mach-Zehnder interferometric waveguide modulator.

と高周波の電界の測定を分けて考える。

まず,低周波用のアンテナについて,特に低周波側 の遮断周波数について検討する。

高圧送電線下の電界をFig.1に示すようなシステムで 測定する場合に特徴的なことは,60Hz電界を例に取れ ばその波長は5×10⁶mであり,その測定は近傍界での 測定である。このため,測定すべき電界は静電界であ る。さらに,センサに用いるLN導波型光変調器は,低 周波域では極めて高い入力インピーダンスのデバイス であるということが通常の電界検出と大きく異なる。

そこでFig. 4に示すような2枚の金属板からなるフ rラディープレート⁹⁾による静電界検出のモデルを考 える。このモデルにおいて,金属板とその間隔,光変 調器は孤立した系と考えることが出来るほど充分に小 さく,あまり電界を乱さないものとする。このとき外 部電界 E_s により2枚の金属板の表裏には静電誘導電荷 が生じる。その電荷密度を σ ,金属板片面に生じる全 電荷量をQとすると,

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{S}_{al} = \boldsymbol{\varepsilon}_o \, \boldsymbol{E}_s \, \boldsymbol{S}_{al} \tag{5}$$

ここで ε_o は真空の誘電率, S_{al} は金属板の面積である。 光変調器電極間にかかる電位差 V_s は,光変調器の電極 間インピーダンス $Z_m \varepsilon Z_m = R_m / (1+j\omega C_m R_m)$ とし,被 測定電界 $E_s = E_o \exp(j\omega t)$ とすると,

$$V_{s} = \frac{j \, \boldsymbol{\omega} \boldsymbol{C}_{m} \boldsymbol{R}_{m}}{1 + j \, \boldsymbol{\omega} \boldsymbol{C}_{m} \boldsymbol{R}_{m}} \cdot \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_{o} \boldsymbol{S}_{al}}{\boldsymbol{C}_{m}} \cdot \boldsymbol{E}_{S} \tag{6}$$

ここで C_m は光変調器容量, R_m はその並列抵抗, ω は電界の角周波数である。式(6)より,Fig. 4の低周波 用アンテナの伝達関数 G_a として,

$$G_{al} = \frac{j \omega C_m R_m}{1 + j \omega C_m R_m} \cdot \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_o S_{al}}{C_m} \longrightarrow \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_o S_{al}}{C_m}$$
(7)

 $\omega >> 1/C_m R_m$

となる⁴⁾。導波型光変調器のインピーダ ンスは C_m は 10^{-12} Fのオーダーであり, R_m は容易に 10^{10} Ω程度以上にできることか ら,低周波側のカットオフ周波数を50Hz 以下にすることが可能になる。

高周波用のアンテナにはダイポールアン テナを用いるものとする。Fig. 5にLN光変 調器と組み合わせた等価回路を示す。伝達関数G_ahは次の式であらわされる。

$$G_{ah} = \frac{h_e Z_m}{Z_{ah} + Z_m} \tag{8}$$

ここで、 h_e はアンテナの実効長、 Z_{ah} はアンテナの 給電点インピーダンス、 Z_m はアンテナの負荷となる 光変調器のインピーダンスである。 h_e 、 Z_{ah} は理論的 な計算はかなり困難であるが、ここでは全体の見通し を立てるために、次のような近似を行う。アンテナの 全長は測定しようとする電磁波の波長より十分に小さ く、実効長 h_e は周波数依存性がなく一定値で、給電点 インピーダンスは容量性である¹⁰⁾とする。また、光 変調器インピーダンス Z_m もほとんど容量のみとし、 その値 C_m はアンテナの容量 C_{ah} より充分大きいとす る。すなわち、 $Z_{ah} = 1/j\omega C_{ah}$ 、 $Z_m = 1/j\omega C_m$ 、 $C_{ah} << C_m$



Fig. 4 Schematic drawing of electrostatic filed measurement with a pair of metal plates and Ti:LiNbO₃ waveguide modulator.



Fig. 5 Equivalent circuit of high frequency electric field measurement.

である。このとき式(8)は,

$$\boldsymbol{G}_{ah} = \frac{\boldsymbol{h}_{e}\boldsymbol{C}_{ah}}{\boldsymbol{C}_{ah} + \boldsymbol{C}_{m}} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{h}_{e}$$
⁽⁹⁾

ここで*K* = *C_{ah}/C_m*で分圧比とする。このような近似により使用周波数帯域内では一定の実数値として扱う。

2.4 光源および受光系

光ファイバ,光源,光検出器の選択においては,使 用する光波長の選択が最も重要となる。現在のところ 0.8µm帯が取扱いも容易で,多くのデバイスが整備さ れているが,1.3~1.5µm帯ではTi:LN光集積回路の光 損傷の問題が小さく¹¹⁾,より安定性にまさることか ら使用波長として1.3µmを用いる。

<u>光ファイバ</u>

光源・光変調器間の光ファイバはシングルモード導 波路との結合効率,MZ型光変調器の偏波依存性を考 慮して偏波面保存ファイバ(以下PMF; Polarization Maintaining optical Fiber)を用いる。光ファイバの伝達 関数G_fとしては,本検討における周波数帯域及びファ イバ長では挿入損失を考えるだけでよい。

$$\boldsymbol{G}_{fi} = (1 - \boldsymbol{\alpha}_{i} \boldsymbol{L}_{fi})(1 - \boldsymbol{\alpha}_{ci}) \tag{10}$$

ここで添字iは, Fig. 1におけるuまたはdで,各々,光 源から光変調器に行く光ファイバ,光変調器から光検 出器に行く光ファイバのものを示すが,Fig. 3の反射型 光変調器を用いた場合では同じものになる。αは光ファ イバ単位長あたりの損失,L_fは光ファイバの全長,αは 光ファイバと光変調器との結合にともなう損失である。

<u>光源</u>

MZ型光変調器の干渉計の光路長差は極めて小さく, 光源はコヒーレンス長が短いものでも使用可能である。

発振形態は連続発振で動作させるので特に伝達関数 を考慮する必要はない。

<u>光検出器</u>

InGaAs/InPのPINフォトダイオード(以下PIN-PDと 記す),アバランシェフォトダイオード(以下APDと 記す),Ge-APD等がある。伝達関数*G*_dは一般的な負 荷抵抗*R*_Lによる光電流の電流/電圧変換を考えて,

$$G_d = r_d \cdot M / (1 + j \omega C_d R_L)$$
(11)

と表現できる。ここで r_d は光電変換感度[A/W]で, Mはアバランシェ増倍係数(PIN-PDの場合はM = 1, APDで $M \neq 1$), C_d はダイオードの接合容量である。

<u>検出限界の理論検討</u>

電界強度入力*E_s* = 0のとき光検出器の出力電流 (=雑 音電流)*i_n*は,自乗の時間平均値で記述され,

$$\langle \boldsymbol{i}_{n}^{2} \rangle = \boldsymbol{B}_{w} \left[\frac{4kT}{R_{L}} + 2e \left\{ \boldsymbol{I}_{d} + \boldsymbol{r}_{d} (\boldsymbol{P}_{av} + \boldsymbol{P}_{on}) \right\} \boldsymbol{M}^{2} \boldsymbol{F} \right]$$
(12)

ここで B_w は測定周波数帯域幅,kはボルツマン定数, Tは光検出器負荷抵抗 R_L の絶対温度,eは電子電荷, P_{av} は受光量の時間平均値, P_{on} は光源雑音, I_d は光検 出器の暗電流,Fは光検出器の過剰雑音指数(PIN-PD の場合はF = 1)である。

平均受光パワー*P_{av}*はMZ型光変調器を用いるときは,最大受光パワーの約1/2になる

いま,光源雑音のない($P_{on} = 0$)理想的なシステム を仮定する。また,その他の条件として光検出器には PIN-PDを用いることにする(F = 1, M = 1)。

まず,光検出器信号のS/N比を求める。

$$SNR = \frac{i_s^2}{\langle i_s^2 \rangle} = \frac{(G_a G_d G_m G_f^2 P_o E_s)^2}{\langle i_s^2 \rangle}$$
(13)

ただし $G_{fd} = G_{fi}$ (反射型光変調器)とした。

Tabl	e 1	Val	lues	used	in	calc	ulatior	ı of	E_{NF} .

		Low frequency type	High frequency type
Opt. power in fiber			
	P_o [mW]	1.0	
Modulator			
Capacitance	C_m [pF]	10	5
Insertion loss	α_m	0.66	
Fiber/Waveguide			
Coupling loss	α_{c}	0.2	
Opt. fiber			
Loss	α_{f}	0.5 [dB/km]	
Length	<i>L</i> [m]	30	
Photo diode			
Sensitivity	r_d [A/W]	0.8	
Load	$R_L[\Omega]$	1000	50
Temperature	<i>T</i> [K]	300	
Dark current	I _d [nA]	10	50

次に検出限界を求める。式(13)においてSNR = 1で, かつ測定周波数帯域幅 $B_w = 1$ [Hz]としたときの電界強 度が測定できる最小電界強度である。

これを*E_{NE}*[Vm⁻¹Hz^{-1/2}]¹²⁾とすると,

$$\boldsymbol{E}_{NE} = \frac{2\boldsymbol{V}_{\boldsymbol{\pi}} \sqrt{4\boldsymbol{k} \boldsymbol{T}/\boldsymbol{R}_{L} + 2\boldsymbol{e} \left(\boldsymbol{I}_{d} + \boldsymbol{r}_{d} \boldsymbol{P}_{av}\right)}}{\boldsymbol{\pi} \boldsymbol{r}_{d} (1 - \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{L}_{f})^{2} (1 - \boldsymbol{\alpha}_{c})^{2} (1 - \boldsymbol{\alpha}_{m}) \boldsymbol{P}_{o}} \cdot \frac{1}{\boldsymbol{G}_{a}} \qquad (14)$$

式(14)にTable 1に示す具体的な数値を代入して求め たこの電界強度測定器の理論的検出限界 E_{NE} の様子 を,Fig. 6,Fig. 7に示す。Fig. 6は低周波用の場合で, 半波長電圧 V_{π} [V]を横軸に,金属平板アンテナの面積 S_{al} [mm²]をパラメータにして示したものである。また Fig. 7は高周波用の場合で,同様に半波長電圧 V_{π} を横 軸に,ダイポールアンテナの実効長 h_e と分圧比Kの積 をパラメータにして測定帯域幅 B_w = 1000[Hz]のときの







Fig. 7 Noise equivalent electric field for high frequency field measurement.

豊田中央研究所 R&D レビュー Vol. 29 No. 3 (1994.9)

検出できる最小電界強度を示したものである。

Fig. 6より,検出限界を 10^{-2} V/mにするには,低周波用の場合,アンテナ面積 $S_{al} > 50$ mm²,半波長電圧 $V_{\pi} < 10$ Vとすれば良いことが分かる。

また,高周波用の場合には検出限界を 10^{-2} V/mにするには, h_e ・Kを 30×10^{-4} [m]以上に設定することが条件となり,分圧比Kを0.1程度とすると30mm程度の実効長のダイポールアンテナが必要になる。

<u>周波数応答</u>

低周波電界計測を考えた場合には, Fig. 4のアンテナ を用いたときの低周波側の遮断周波数f_eは式(7)より,

$$f_{cl} = \frac{1}{2\pi C_m R_m} \tag{15}$$

高周波側については,光変調器,アンテナ,給電方 法は適正な設計により広帯域化が可能で,現実の素子 の特性を考慮すると,光検出器の応答が全体の周波数 応答を制限する場合が多い。この場合の高周波側の遮 断周波数f_{ch}は式(11)より,

$$f_{ch} = \frac{1}{2\pi C_d R_L} \tag{16}$$

3 . 試作実験

3.1 センサ部構成

上記の内容に基づき製作した低周波用電界計測のためのMZ型光変調素子をFig.8に示す。



L Ti indiffusion waveguides

Fig. 8 Details of integrated optical device of retroreflective modulator for low frequency measurement.

干渉計の2つのアームの光路長差は157nmで,これは 導波路内では1/4波長にあたる。すなわち,位相バイア ス $\phi_0 = \pi/2$ である。基板はZ_cut板を用いた。導波路は 線幅7µm,膜厚500ÅのTi膜をリフトオフ法にてLN基 板上にパターニングした後,熱拡散(1025°C,8hr)して 作製した。位相変調部の電極長は前節で求めたように $V_{\pi} < 10V$ とするために, $L_m > 15$ mmとしてある。Fig. 8 に示すように,実際には全長短縮と低周波特性改善の ため,両導波路に電極を設置するので,1/2の電極 長(7.5mm)でよい。また,金属クラッディングによ るTMモード伝搬損失の増大を防ぐため,SiO₂バッフ ァ層(膜厚 3000Å)を電極下に設けてある。電極は下 からCr(膜厚500Å), Al(3µm), Au(2000Å)の構成で ある。Fig. 8の素子の入出力特性をFig. 9に示す。

横軸は光変調器への入力電圧、縦軸は出力光量(光 検出器出力より換算)である。図より半波長電圧V_πは 約6Vであることが読み取れる。この特性は素子単独 の場合,電圧印加で1Hz~10MHz以上まで保たれるこ とを確認している。

Fig. 10に高周波用の素子を示す。電界検出のダイポ ールアンテナの構成として,光変調器と同一のLN基板 上に金属薄膜を堆積させて作製する方法と,通常のダ イポールアンテナに光変調器を接続する方法があるが, 小型化,安定性の点で本検討では前者を用い,光変調 電極と一体化した薄膜アンテナを用いている。アンテ



Fig. 9 Oscilloscope trace of modulated light output from modulator vs applied voltage.

ナの形状はモーメント法による数値計算で求めた。周 波数特性をシミュレートしながら,アンテナの先端の 幅を微調整(電極幅は固定)して最適化した。高周波特 性を向上させるためには,電極構成は低周波用と逆に 電極間容量を減らす必要があり,両導波路上に装荷し た一対だけにしてある。それ以外は低周波用の光集積



Fig. 10 Details of integrated optical device of retroreflective modulator for high frequency measurement.



Fig. 11 Configuration of sensors.

回路と同一である。

Z_cut基板を用いた光集積回路で問題になるのは温 度による特性ドリフトである。これは焦電効果によっ て発生した電荷が電極下に不均一に滞留し,内部電界 を生じてバイアス点を変動させる機構で説明されてい る¹³⁾。この対策として,我々はこれにバッファ層堆 積時のプリスパッタを利用し,LN基板最表面にごく 薄い欠陥層(低抵抗層)を形成,滞留電荷はこの層を 通じてリークし,均一化され温度ドリフトが低減する 方法を開発した⁵)。

試作したセンサ部の構造をFig. 11に示す。

導波路と入出力光ファイバの結合方法には光ファイ バ端面と導波路端面の直接突合せで結合させる方法を 用いた。低周波用のアンテナは,2.5節で求めたよう に75mm²の銅板(5×15×0.5^tmm)を用いた。それ以 外の材質は全て誘電体で,光集積回路のベースはセラ ミック(マッコール™),外囲器はポリカーボネート 樹脂である。組立は接着またはポリ

カーボネート樹脂製ボルトによるネ ジ止めとした。

3.2 光源部構成

同一光路を信号光が戻ってくる反 射型光変調器を用いる場合の光源に 注意すべき点は,光ファイバとLN変 調器の接続部などでの反射戻り光と 信号光の干渉を避けることと,戻り 光で光源自身の発光が不安定になら ないことである。1.3µ帯の使用可能 な光源のなかでは光ファイバとの結 合効率,出力の点でInGaAsP/InP-LD (Laser Diode)が最 も実用的であるが,DFB(Distributed Feed Back)-LDは可 干渉性が高く用いることはできないことから,本検討 では縦マルチモードで低コヒーレンスのFP (Fabri-Perot)共振器型の 1.3μ 帯LDを用いる。さらに,Fig. 12に示 すようにLDに積極的に反射光を戻すことにより,発振 光のスペクトル線幅を増大¹⁴⁾させ,擬似的にインコ ヒーレント化している。

4.特性・考察

低周波用電界センサ特性

試作した低周波用センサの特性はFig. 13に示す実 験系で測定した。2枚の模擬電界発生部の電極間隔は, 挿入したセンサ部の影響が無視できるようにセンサの 大きさの5倍以上とした。Fig. 14は周波数応答で電界 強度は100V/m一定で測定した結果(黒丸)である。図に は信号源からの電圧を直接,電極に印加した場合の周



Fig. 12 Optical system for retroreflective modulator.



Fig. 13 Experimental setup for measurements of low frequency field sensor properties.



Fig. 14 Frequency responses of low frequency field sensor.

波数応答も示した(白丸)。図中に示したように電界測 定の場合の低周波側のカットオフは30Hzであった。 これはセンサ部のインピーダンス測定値, Cm~10pF, R_m~10⁹Ωから式(7)で導かれる値とよく一致してい る。Fig. 15はアンテナ面積を変化させたときの感度の 変化を測定した結果で,感度はアンテナ面積にほぼ比 例している。また, Fig. 16はセンサの指向性の測定結 果で,電界の方向とセンサの中心線がなす角に対する 感度の変化を測定したものである。図中に示した実線 はCOS のである。この結果は電界の方向からみた実効 アンテナ面積がS・COS ので変化することにより説明で きる。以上の周波数応答、アンテナ面積依存性、角度 依存性等の結果より, Fig. 4のモデル及び式(7)はほぼ 妥当なものであると考えられる。Fig. 17は入出力特性 で,横軸は印加電界(電極間印加電圧/電極間隔), 縦軸は信号処理回路の出力電圧である。センサのダイ ナミックレンジとして4桁以上が得られている。検出 限界は前置増幅器の出力電圧をロックイン増幅器(時 定数1sec)に入力して測定した結果,約0.01V/mと見 積られた。実測された $V_{\pi} = 6V$ と式(14)を用いて推定 される検出限界(4.2×10⁻³V/m)にかなり近い。セン サ部単独の感度は光変調器電極間電圧換算で 0.5mV/(V/m)であった。これは式(7)で見積られる値の 約7.5倍である。これは仮定として金属板等により電 界は乱れないものとしたが,電気力線はかなり湾曲す る。またLN基板(比誘電率 E_{IN} 20~40)の影響も考え られる。これらの効果を考慮して,式(7)の金属板面 積 S_{al} は実効面積 S_{aeff} に置き換える必要があるものと考 えられる。感度の温度ドリフトはFig. 13の電極板とセ ンサ部を恒温槽に入れて行った。結果は±10%/±15 であった。やや大きく今後の検討課題である。根本的 解決には感度を犠牲にしてY_cutまたはX_cut基板で光 波Z軸伝搬の構成を用いる必要があると思われる。

Fig. 18に高周波用電界センサの周波数特性を示す。 測定はTEMセルまたは電波暗室内でホーンアンテナ 等で所定の周波数の電界(強度100V/m一定)を発生さ せて行った。30MHz~1GHzの範囲で±2.5dBのほぼ平 坦な周波数特性が得られている。低周波側,高周波側 のカットオフは各々10MHz,1.1GHzで,ともに光検 出器/前置増幅器の特性で制限され,予想した特性と よく一致している。Fig. 19に高周波用電界センサの入 出力特性測定系を,Fig. 20に測定結果を示す。



Fig. 15 Variation of sensitivity with metal plate area.



Fig. 16 Angular response of low frequency field sensor.



Fig. 17 Electric field response of low frequency field sensor.

検出限界はスペクトラムアナライザの測定帯域幅 1kHzのとき0.6V/m (30MHz~1GHz) であった。これ はアンテナの給電点インピーダンスがかなり大きく, アンテナで発生した電圧が有効に導波路部に印加され ていないためと考えられる。Fig. 21はアンテナのAl 膜厚を変化させたときの,センサの電界検出感度の変 化を示したもので,明らかに膜厚増加(抵抗減少)に より感度が向上している。これは薄膜アンテナの抵抗 がかなり大きく分圧比Kがかなり小さいことを示唆し ている。アンテナの最適化は今後の検討課題である。

Fig. 22に開発した電界強度測定器の外観を,また Table 2に機能・性能をまとめる。

6.まとめ

商用電源周波数(50,60Hz)から1GHzまでの周波数 帯域をカバーする広帯域で小型・軽量な電界強度測定 器について検討を行った。その結果, Ti:LiNbO3導波 型光変調器を用いた手法により実現可能であることを 導出した。その結果にもとづき,低周波用には金属平 行平板によるアンテナを,高周波用にはLN基板に電 極と一体化した薄膜アンテナを用い,これらと新たに 考案した反射型 Mach-Zehnder 型光変調素子により電 界検出センサを構成し,信号伝送路に光ファイバを使



Fig. 18 Frequency response of high frequency field sensor.



Fig. 19 Experimental setup for measurements of high frequency field sensor properties.

22

5. 適用例

減できる。



Fig. 20 Electric field response of high frequency field sensor.

	Low frequency type	High frequency type
Bandwidth	30Hz - 100kHz	30MHz - 1GHz
Measurement Range (V/m)	0.1 - 1000 over (Display 1 - 1000)	0.6 - 300
Size (mm)	$43L \times 16W \times 10H$	43L × 45W × 10H
Temp. Drift	$<\pm10\%$	$< \pm 1 dB$







Fig. 23 Photograph of on-site measuring of ELF field in car under high voltage power lines.



a) Low frequency type



b) High frequency type





Units : V/m Fig. 24 Results of ELF field measurements.

用した測定器を試作し、その機能を確認した。

しかしながら,温度ドリフト等に関しては,さらに 検討が必要である。

謝辞

本研究を進めるに際して協力をいただいたトヨタ自 動車・電子技術部の近藤次長,稲津担当員,森田氏, 森泉氏,中西氏に感謝します。また本研究所・西川主 任研究員らにご協力いただきました。

また有用な示唆をいただいた米国NISTの神田博士, K.D.Masterson 博士に心より謝意を表します。

参考文献

- 1) Bulmer, C. H. : Proc. SPIE, 517(1984), 177
- 中島, et al.:第3回光波利用センシング研究報告, T5-4(1989), 263
- 3) Masterson, K. D., et al. : Proc. SPIE, 987(1989), 107
- 伊藤, et al.: 電子情報通信学会技術研究報告, EMCJ90-96(1990)
- 5) 伊藤, et al.: 第7回光波利用センシング技術研究会, LST7-8(1991), 51
- 光集積回路,応用物理学会光学懇話会編,(1988),朝倉
 書店
- 7) 三浦,皆方,川上:電子情報通信学会技術研究報告, OQE87-26(1987)
- 8) 市川, et al.: 計測制御学会講演会SICE'92予稿集, (1992), DS45-2
- 9) 静電気ハンドブック, 電気学会編, (1981), オーム社, 348
- 10) アンテナ工学ハンドブック,電子通信学会編,(1980),オ ーム社,41
- 11) Harvey, G. T., et al. : IEEE J. Quantum Electron., 22-6, (1986)
- 12) Masterson, K. D. (米国NIST)の提案による
- 13) 佐脇, et al.: 電子情報通信学会技術研究報告, OQE86-44(1986)
- 14) Miles, R. O., et al. : Appl. Phys. Lett., 37-11, (1982), 990

豊田中央研究所 R&D レビュー Vol. 29 No. 3 (1994.9)

著者紹介



伊藤博 Hiroshi Ito 生年:1949年。 所属:光応用研究室。 分野:光応用計測,光集積回路。 学会等:応用物理学会,計測自動制御学会 会員。



市川正 Tadashi Ichikawa 生年:1961年。 所属:光応用研究室。 分野:光集積回路。